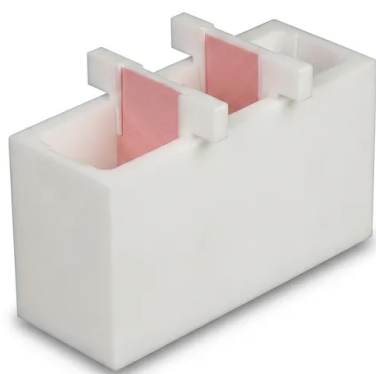


# Cella Elettrochimica Quadrata In Ptfе Per La Elaborazione Di Wafer Di Silicio E Resistenza All'acido Fluoridrico Nella Ricerca Sui Semiconduttori E Le Nuove Energie Fonti

Numero articolo: PL-CP151



## introduzione

Questa cella elettrochimica quadrata in PTFE ad alta purezza offre un'eccezionale resistenza all'acido fluoridrico per la lavorazione dei wafer di silicio nei settori dei semiconduttori e delle nuove energie rinnovabili, caratterizzata da dimensioni completamente personalizzabili e un'ingegnerizzazione su misura rigorosa per soddisfare specifiche esigenze di ricerca di laboratorio e produzione industriale.

## Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
<b>Incisione Wafer Semiconduttori</b>	Utilizzata per la rimozione controllata di strati di materiale dai wafer di silicio utilizzando incisori a base di HF.	Nessuna degradazione del materiale e contenimento preciso di acidi aggressivi.
<b>Ricerca Fotovoltaica</b>	Test e ottimizzazione dell'efficienza elettrochimica degli strati e dei rivestimenti delle celle solari a base di silicio.	Distribuzione uniforme del campo su substrati quadrati di grande formato.
<b>Test Batterie al Litio</b>	Alloggiamento di elettroliti corrosivi per l'analisi delle prestazioni di anodi e catodi nei nuovi dispositivi di accumulo di energia.	Completa inerzia contro le chimiche delle batterie avanzate e i sali elettrolitici.
<b>Nanofabbricazione e MEMS</b>	Recipiente specializzato per la fabbricazione di Sistemi Micro-Eletto-Meccanici che richiedono bagni chimici ad alta purezza.	Prevenzione della contaminazione da metalli in tracce durante le fasi di lavorazione critiche.
<b>Processi di Galvanostegia</b>	Deposizione di metalli su substrati semiconduttori o componenti correlati all'energia in bagni acidi o alcalini.	Resistenza sia a livelli di pH estremi che ad alte densità di corrente durante le operazioni di plating.
<b>Scienza della Corrosione</b>	Studio della durata dei materiali in ambienti altamente aggressivi, come quelli presenti nella lavorazione chimica.	Contenimento affidabile che supera vetro e polimeri standard nell'esposizione a lungo termine.

Specifiche	Dettagli per PL-CP151
<b>Numero Articolo Prodotto</b>	PL-CP151
<b>Materiale Principale</b>	PTFE ad Alta Purezza (Politetrafluoroetilene)
<b>Configurazione Vasca</b>	Vasca Monolitica Quadrata / Rettangolare
<b>Compatibilità Chimica</b>	Acido Fluoridrico, Acqua Regia, Acido Solforico, Alcali Forti, Solventi Organici
<b>Compatibilità Substrato</b>	Wafer di Silicio (Personalizzabili per 2", 4", 6", 8", 12" o dimensioni su misura)
<b>Intervallo Temperatura di Esercizio</b>	-200°C a +260°C
<b>Opzioni di Personalizzazione</b>	Dimensioni su misura, spessore parete e posizionamento porte secondo disegni del cliente
<b>Processo di Produzione</b>	Lavorazione CNC di Precisione (End-to-End)
<b>Componenti di Sigillatura</b>	Coperchi PFA/PTFE opzionali, Guarnizioni FKM/PTFE e raccordi PFA

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Specifiche	Dettagli per PL-CP151	

**Finitura Interna** Superficie ultra-liscia e a bassa porosità per minimizzare l'accumulo di residui